

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年1月24日(2008.1.24)

【公表番号】特表2003-515943(P2003-515943A)

【公表日】平成15年5月7日(2003.5.7)

【出願番号】特願2001-542269(P2001-542269)

【国際特許分類】

H 01 L 21/027 (2006.01)

G 01 B 11/06 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/30 5 6 4 D

G 01 B 11/06 Z

【手続補正書】

【提出日】平成19年11月27日(2007.11.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0020】

図3を参照すると、光強度が最適化されると、本工程の次の手順は、ノズル34から基板32にホトレジスト材料48を施与することである。ホトレジストを施与する際には、仕様により必要とされるホトレジスト層の厚みに応じて、基板32は静止施与では静止状態にあり、動的施与では回転機構33により回転状態にある。ホトレジスト材料48が基板32に接触すると、カメラ38はこの事象を検出することになる。材料48の基板32への接触が適切な時期に検出されると、適切なホトレジストの量が確実に堆積されることになる。